

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年10月27日 (27.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/101483 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/66

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/007120

(22) 国際出願日: 2005年4月13日 (13.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-117910 2004年4月13日 (13.04.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): コマツ  
電子金属株式会社 (KOMATSU ELECTRONIC MET-  
ALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四  
之宮3丁目25番1号 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 銚島 ふみ

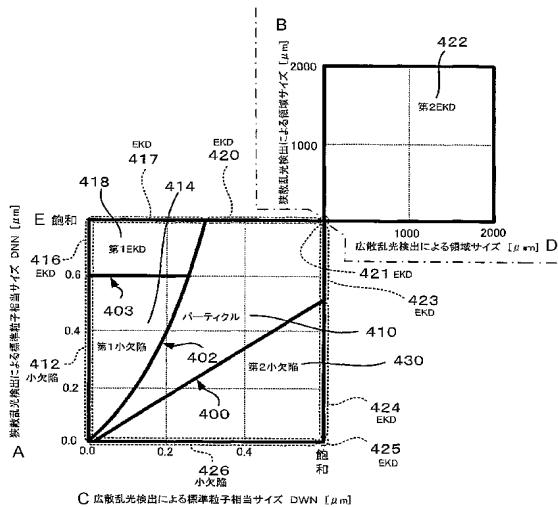
(NABESHIMA, Fumi) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平  
塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式  
会社内 Kanagawa (JP). 富樫 和也 (TOGASHI, Kazuya)  
[JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目  
25番1号 コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa  
(JP). 自見 博志 (JIKEN, Hiroshi) [JP/JP]; 〒2540014 神  
奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号 コマツ電子金  
属株式会社内 Kanagawa (JP). 末永 好範 (SUENAGA,  
Yoshinori) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之  
宮3丁目25番1号 コマツ電子金属株式会社内  
Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 ウィルフォート国際特許事  
務所 (WILLFORT INTERNATIONAL); 〒1010035 東  
京都千代田区神田紺屋町16 クニイビル2F Tokyo  
(JP).

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR WAFER INSPECTION DEVICE AND METHOD

(54) 発明の名称: 半導体ウェハの検査装置及び方法





(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。